國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班 碩 士 論 文

利用 T 型 間 極 與 氨 氣 電 漿 處 理 提 升 薄 膜 電 晶 體 元 件 可 靠 度 之 研 究

Improving reliability characteristics of TFTs by T-gate structure and NH₃ passivation

研究生:蔣陳偉

指導教授:葉清發 教授

中華民國九十四年六月

利用 T 型 閘極與氨氣電漿處理提升薄膜電晶體元件可靠度之 研究

Improving reliability characteristics of TFTs by T-gate structure and NH₃ passivation

研究生:蔣陳偉 Student: Chen-Wei Chiang

指導教授: 葉清發教授 Advisor: Dr. Ching-Fa Yeh

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文

A Thesis

Submitted to Department of Electronics Engineering & Institute of Electronics

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chaio Tung University

in Partial Fulfillment of Requirements

for Degree of Master of Science

in

Electronics Engineering

June 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年六月